

### Exercice 1 : Semi-conducteur intrinsèque

On considère un semi-conducteur intrinsèque dont les densités équivalentes d'états énergétiques dans la bande de conduction et dans la bande de valence sont notées respectivement  $N_C$  et  $N_V$ .

1. Rappelez les expressions de la densité d'électron  $n$  dans la bande de conduction et la densité de trous  $p$  dans la bande de valence.

2. En déduire l'expression de la densité intrinsèque  $n_i$  et la position du niveau de Fermi intrinsèque  $E_{Fi}$

3. Le semi-conducteur considéré est du silicium de largeur de bande interdite (ou gap)  $E_g = 1,11\text{eV}$  et pour lequel  $N_C = 2,710^{19}\text{cm}^{-3}$  et  $N_V = 1,110^{19}\text{cm}^{-3}$

En supposant que  $E_g$ ,  $N_C$  et  $N_V$  ne varient pas avec la température ; calculez sa densité intrinsèque et la position du niveau de Fermi à  $27^\circ\text{C}$ ,  $127^\circ\text{C}$  et  $227^\circ\text{C}$  puis conclure.

On donne  $k = 1.3810^{-23}\text{J/K}$  et  $kT = 26\text{meV}$  à  $300^\circ\text{K}$ .

On prendra comme référence énergétique, le haut de la bande de valence ( $E_V = 0\text{eV}$ ).

#### Correction :

1. Expressions des densités d'électron et de trou :

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) \quad \text{et} \quad p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

2.

▪ Densité intrinsèque  $n_i$  :

Le semi-conducteur étant intrinsèque, on a donc :  $n = p = n_i$

$$\implies n_i = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$

$$n_i^2 = n.p$$

$$\text{d'où : } n_i = \sqrt{n.p} = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_C - E_V}{2kT}\right)$$

▪ Niveau de Fermi intrinsèque  $E_{Fi}$  :

$$\text{On a : } n/p = 1 \implies \frac{N_C}{N_V} \exp\left[\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right) + \left(\frac{E_F - E_V}{kT}\right)\right] = 1$$

$$\text{D'où : } E_{Fi} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_V}{N_C}$$

3. A.N :

Il faut convertir la température en Kelvin :

$$27^\circ\text{C} = 300\text{K}, \quad 127^\circ\text{C} = 400\text{K} \quad \text{et} \quad 227^\circ\text{C} = 500\text{K}$$

$$T=300\text{K} : kT = 26\text{meV}$$

$$T=400\text{K} : kT = \frac{1,3810^{-23} \cdot 400}{1,610^{-19}} = 34,5\text{meV} \quad \text{et pour } T=500\text{K}, kT=43,1\text{meV}$$

T(K)	KT (meV)	$n_i(\text{cm}^{-3})$	$E_{F_i}(\text{eV})$
300	26	$9.244 \cdot 10^9$	0.543
400	34.5	$1.777 \cdot 10^{12}$	0.539
500	43.1	$4.405 \cdot 10^{13}$	0.535

c/c : plus la température augmente, plus il y a génération des paires électron-trou ; d'où l'augmentation de la densité intrinsèque du S.C. Le niveau de Fermi intrinsèque se rapproche légèrement de celui de la bande de valence.

## Exercice 2 : Semi-conducteur extrinsèque

On considère un matériau semi-conducteur en silicium dopé avec du phosphore (groupe V du tableau périodique) de concentration  $N_D = 10^{18} \text{cm}^{-3}$

1. Calculez à  $27^\circ\text{C}$ , la densité d'électrons du Si ainsi dopé. En déduire la densité de trous. Quel est le type du semi-conducteur ainsi obtenu ?
2. Calculez à  $27^\circ\text{C}$  la position du niveau de Fermi  $E_F$  puis donnez une représentation du diagramme de bandes d'énergies du silicium ainsi dopé.

On donne :  $n_i = 1,12 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ,  $E_g = 1,11 \text{ eV}$ ,  $KT = 26 \text{ meV}$  pour  $T = 27^\circ\text{C}$

### Correction :

1. Le phosphore, P, est une impureté de type donneur:  $N_D = 10^{18} \text{cm}^{-3}$ .

ainsi la densité d'électrons est égale à la densité de donneurs :

$$n = N_D = 10^{18} \text{cm}^{-3}$$

Selon la loi d'action de masse la densité de trous est donnée par :

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1,12 \times 10^{10})^2}{10^{18}} = 125 \text{ cm}^{-3}$$

c/c Le semi-conducteur obtenu est de type N

2. L'énergie de Fermi peut être déduite de la densité d'électrons comme suit :

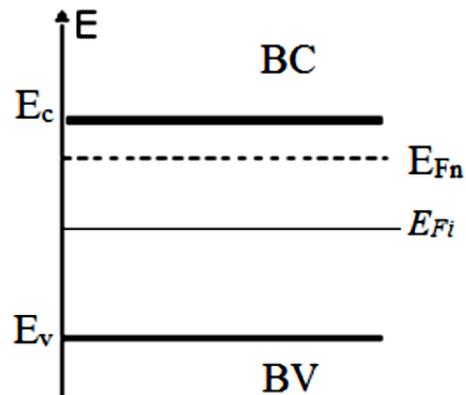
$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{F_n}}{kT}\right) \approx N_D \Rightarrow N_D = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{F_i} + E_{F_i} - E_{F_n}}{kT}\right)$$

$E_{F_n}$  est le niveau de Fermi pour un SC dopé N,  $E_{F_i}$  est le niveau de Fermi du SC intrinsèque.

$$\Leftrightarrow N_D = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{F_i}}{kT}\right) \exp\left(-\frac{E_{F_i} - E_{F_n}}{kT}\right) = n_i \exp\left(-\frac{E_{F_i} - E_{F_n}}{kT}\right)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{E_{F_i} - E_{F_n}}{kT} = \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) \Rightarrow E_{F_n} = E_{F_i} + kT \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

A.N  $E_{F_n} = \frac{1.11}{2} + 0.026 \ln \frac{10^{18}}{1.12 \cdot 10^{10}} \approx 1,09 \text{ eV}$



c/c : pour un S.C type N, le niveau de Fermi est proche de la bande de conduction ; par contre pour un S.C type P, il est proche de la bande de valence.